

分子电镀法定量沉积铀和钷

@严叔衡 @苏树新 @张淑兰

收稿日期 修回日期 网络版发布日期:

摘要 本文较详细地研究了分子电镀法定量沉积铀和钷的各种条件,推荐了一个定量制备铀和钷标准源(或靶)的程序。在推荐的条件下,铀和钷的平均沉积率大于99%,定量误差为±1%。镀层的均匀性和牢固性测量表明,镀层的质量能满足裂变产额等核参数测量和α能谱测量的要求。

关键词

分类号

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]\(735KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)

Abstract

Key words

DOI

通讯作者